

プログラム

第1日: 2017.9.11(月)

[12:00-13:00 総括班会議(総括班のみ; 理学 H 棟 6 階 H623)]

全体会議 (理学 H 棟 7 階 H701)

12:45-13:00 受付

13:00-13:10 領域代表から領域運営および状況の報告・今後の方針と予定の説明

13:10-13:20 領域イベント活動報告・事務連絡・今後の予定

13:20-14:20 研究成果報告と共同研究の進捗、促進計画(各班長)

楠、長汐、長田、越野:(講演 12 分+質疑応答 3 分)

[休憩 10 分]

14:30-15:30 研究成果報告と共同研究の進捗、促進計画

4 名:(講演 12 分+質疑応答 3 分)

合成班:丸山茂夫(東大工)「グラフェン, hBN, MoS₂ の CVD 合成」

応用班:谷口尚(物材機構)「液相成長法による六方晶窒化ホウ素単結晶の合成と不純物制御の現状」

物性班:八木隆多(広大先端物質)「グラフェンのフェルミ面」

理論班:越野幹人(阪大理)「少数層グラファイトにおける電子間相互作用効果」

15:30-16:00 研究成果報告と共同研究成果発表

3 名:(講演 8 分+質疑応答 2 分)

合成班:齊木幸一朗 (東大新領域)「酸化グラフェン塗布膜のその場高次還元」

合成班:吾郷浩樹 (九大グローバルイノベーションセンター)「二次元材料の高品質成長と共同研究の発展」

合成班:坂本良太(東大理)「分子ナノシートの機能創出」

[休憩 20 分]

16:20-17:30 研究成果報告と共同研究成果発表

7 名:(講演 8 分+質疑応答 2 分)

応用班:秋田成司(大阪府大工)「グラフェン/MoS₂ 積層原子層膜の機械的共振」

応用班:長谷川雅考(産総研)「大面積グラフェンの透明電極応用」

応用班:塚越一仁(物材機構)「ナノヘテロ構造の電気伝導」

物性班:菅原克明(東北大材料科学高等研)「遷移金属カルコゲナイド原子層の高分解能 ARPES」

理論班:斎藤晋(東工大理工)「積層パターンによる h-BN 膜のバンド構造エンジニアリング」

理論班:若林克法(関学大理工)「蜂の巣格子系におけるトポロジカル状態の設計」

理論班:齋藤理一郎(東北大理)「グラフェンの電磁波吸収」

[移動 10分]

17:40-18:10 各班で打ち合わせ

[理学 B 棟 301(合成), 302(物性), 307(応用), 308(理論)]

18:30-20:00 懇親会 (豊中キャンパス内「らふおれ」)

第2日:2017.9.12(火)

9:00-10:30 研究成果報告と共同研究成果発表 (理学 H 棟 7 階 H701)

9名:(講演8分+質疑応答2分)

合成班:田中隆行(京大理)「ポルフィリン原子層の開拓と二層状分子の合成」

合成班:大久保将史(東大工)「原子層化合物 MXene の物性解析」

応用班:野内 亮(大阪府大)「原子層物質の表面修飾と応用」

応用班:長汐晃輔(東大工)「2次元層状電子デバイスの界面特性」

物性班:小山剛史(名大工)「基板を活用したグラフェンの光キャリア緩和の高速化」

物性班:青木伸之(千葉大融合科研)「レーザー照射による MoTe₂ の結晶構造と電子物性制御」

物性班:長田俊人(東大物性研)「グラファイトの磁場誘起電子相転移に対する量子サイズ効果」

理論班:是常隆(東北大理)「2次元界面および原子層における強磁性の電子状態」

理論班:岡田晋(筑波大数理物質)「B₃N₃ ドーピングによるグラフェンの電子構造制御」

[休憩・移動 30分]

11:00-12:20 ナノスピソ変換科学・原子層科学合同セッション (基礎工学国際棟シグマホール)

町田友樹(東大生研;原子層科学)

「強磁性層状物質を用いたファンデルワールス接合の作製とスピソ伝導」

新見康洋(阪大理;ナノスピソ変換科学)

「原子層スピソ変換素子を目指して」

山本倫久(東大工;原子層科学)

「原子層物質 におけるスピソバレー流の検証実験」

能崎幸雄(慶應大理工;ナノスピソ変換科学)

「非磁性金属薄膜への表面弾性波注入によるスピソ流生成」

===

終了、解散